

Otázky k SZZ programu Fyzikální měření a modelování

Snímače, detektory, čidla (povinný společný základ I.)

- 1) Principy snímání polohy, měření vzdálenosti, snímání úhlu natočení (mechanické, kontaktní/bezkontaktní, další jiné).
- 2) Principy kontaktního snímání otáček, bezkontaktní snímání.
- 3) Kontaktní snímače hladiny kapalin, sypkých hmot, bezkontaktní snímače.
- 4) Snímače pro měření tlakové síly, tahové síly, točivého momentu, tlaku.
- 5) Principy měření teploty kontaktní/bezkontaktní.
- 6) Mechanické snímání rychlosti proudu kapaliny, plynu, bezkontaktní snímání rychlosti proudu.
- 7) Principy snímání magnetického pole statického, stacionárního v čase proměnného pole.
- 8) Principy snímání úrovně akustického tlaku, vibrací, infrazvuk, ultrazvuk (vzduch, voda, země).

Principy a systémy měřicích přístrojů (povinný společný základ I.)

- 1) Základní pojmy, typy měřicích přístrojů a jejich základní vlastnosti.
- 2) Princip OZ (operační zesilovač), OZ jako měřící zesilovač.
- 3) A/D a D/A převodníky, vlastnosti a typické využití v měřicích přístrojích (voltmetr, osciloskop, funkční generátor, ...).
- 4) Základní bloky měřicího řetězce, jejich vlastnosti a základní vlastnosti. Měřicí přístroj řízený mikroprocesorem.
- 5) Základní principy a funkce kombinačních a sekvenčních logických obvodů a příklady jejich použití v měřicí technice - čítače, registry (posuvné, vyrovnávající, ...), FIFO, LIFO. Základní principy a aplikace pamětí SRAM, DRAM, EEPROM.
- 6) Mikroprocesory a komunikační sběrnice v měřicí technice (RS 232 + varianty, USB, I2C, OneWire, SPI,)

Počítačová fyzika – počítačové modelování (povinný společný základ II.)

1) Molekulární dynamika – princip

Princip molekulární dynamiky, Verletův a Gearovy integrátory, volba integrátoru a integračního kroku.

Radiální distribuční funkce, vyjádření střední hodnoty veličiny (např. energie) pomocí integrálu párové funkce (např. potenciálu) a RDF, dosah potenciálu vs. velikost systému, dlouhodobá korekce energie.

2) Molekulární dynamika – molekulární simulace

Molekulární potenciály – intermolekulární a intramolekulární.

Teplota v MD, termostaty – přeskálování rychlostí, Berendsenův frikční, podstata dalších termostatů (Andersenův, v-rescale).

3) Metoda Monte Carlo

Integrace metodou MC – deterministické vs. náhodné vzorkování. Užití MC pro geometrické problémy – náhodné procházky.

Stochastické procesy, Markovovy řetězce, detailní rovnováha a mikroskopická reverzibilita, Metropolisův algoritmus.

4) Spojité modelování

Popis problémů pomocí spojitého modelování. Klasifikace parciálních diferenciálních rovnic (PDR), okrajové + počáteční podmínky, příklady PDR ve fyzice.

Numerická řešení (explicitní a implicitní schémata) PDR a soustav PDR. Řešení v blízkosti nespojitostí a skoků, „flux limitery“ a AMR. Svojité a hybridní modely (výhody a nevýhody).

Numerická matematika I. (povinný společný základ II.)

- 1) Řešení nelineárních rovnic, metoda bisekce, rychlosť bisekce, Newtonova metoda, kvadratická konvergencia.
- 2) Řešení soustav lineárních rovnic, LU rozklad matice a jeho užití.
- 3) Interpolace funkcií, Lagrangeův a Newtonův interpolační polynom, aproximace funkcí (metoda nejmenších čtverců).
- 4) Integrování a derivování, integrační pravidla a řád chyby integrace, Rombergova interpolace, poměrné diference.

Předměty volitelného okruhu (student volí dva z předmětů)

Modelování elektronických obvodů

- 1) Stručný popis simulačního programu Multisim a příklady simulace pasivních lineárních obvodů s akumulačními prvky (kapacity a indukčnosti)
- 2) Popis simulačního programu Multisim z hlediska měření elektrických veličin na obvodech. Měření stejnosměrných veličin, střídavých veličin a časových průběhů v různých částech obvodů.
- 3) Popis simulace jednoduchého zesilovače střídavého signálu s NPN tranzistorem a měření polohy jeho pracovního bodu a vstupního a výstupního signálu v programu Multisim.
- 4) Popis simulace jednoduchého zesilovače střídavého signálu s unipolárním tranzistorem MOSFET a měření polohy jeho pracovního bodu a vstupního a výstupního signálu v programu Multisim.
- 5) Popis simulace jednoduchého zesilovače střídavého signálu s operačním zesilovačem a měření vstupního a výstupního signálu na zesilovači v programu Multisim.

Modelování a simulace

- 1) Základní pojmy a modelování:
systémy, systémové myšlení, modely a jejich druhy, proces tvorby modelu, způsoby popisu modelu a jejich výhody a nevýhody.
- 2) Simulace:
definice, způsoby zkoumání systému, proces simulace a jeho fáze, výhody a nevýhody, simulační spojité i diskrétní techniky, charakteristika a určení, příklad použití, užití dle úrovně abstrakce.
- 3) Modelování pomocí diskrétních událostí:
základní pojmy, typy algoritmů, třífázový model zpracování událostí, práce s časem, příklad použití, procesní a stavový diagram, komponenty a jejich význam, příklady použití.
- 4) Modelování pomocí systémové dynamiky:
základní pojmy, komponenty a východiska, příčinná a zpětná vazba a dopad na chování systému, PID regulátor, schéma a jeho popis, příklad použití v simulaci.
- 5) Multiagentní modelování:
celulární automaty, hra života, agentový přístup, typy agentů, typy prostředí, vazba na jiné způsoby modelování, příklady použití.
- 6) Nastavení modelu a simulační experiment:
nastavené modelu, práce s náhodnými proměnnými, typy experimentů a jejich charakteristika, příprava experimentů ve vazbě na cíle.

Zpracování audiosignálů

1. Fyzikální akustika. Jednorozměrná vlnová rovnice. Vyzařování zvuku ideální koule.
2. Fyziognomie lidského ucha, vnímání zvuku, psychoakustika. Weber-Flechnerovi křivky, hlasitost a hladina hlasitosti. Maskování. Hluk, hygienické předpisy.
3. Základní typy signálů, charakteristiky, střední hodnota. Frekvenční analýza signálů, Fourierova transformace, Diskrétní Fourierova transformace (FFT, DFT).
4. Akustické veličiny, základní a hladinové vyjádření. Akustický tlak, výkon a intenzita. Mechanismy pohlcování zvuku.
5. Prostorová a stavební akustika. Výpočty doby dozvuku. Akustické úpravy uzavřených prostor. Principy úpravy doby dozvuku.

Numerická matematika II.

1. Řešení systémů lineárních rovnic pomocí iteračních metod – srovnání s přímými metodami, příklady jejich použití, princip metody sdružených gradientů.
2. Řešení úloh na vlastní čísla a zobecnění na úlohu na singulární čísla, zavedení pseudoinverzní matic.
3. Řešení počátečních úloh pro obyčejné diferenciální rovnice a soustav diferenciálních rovnic, příklady metod a jejich implementace.
4. Řešení okrajových úloh pro diferenciální rovnice, příklady metod a jejich implementace.

Electron Microscopy I

- 1) Proč se používají elektrony jako zdroj záření v mikroskopech?
 - Vlastnosti elektronů
 - Rozlišovací schopnost elektronových mikroskopů,
 - Zdroje elektronů
 - Elektromagnetické čočky a jejich vady
 - Tvorba obrazu
- 2) Jak pracuje transmisní elektronový mikroskop
 - Konstrukce TEM
 - Rozlišovací a zvětšovací schopnost TEM
 - Záznam obrazu v TEM
 - Požadavky na biologický preparát
- 3) Jak pracuje rastrovací elektronový mikroskop
 - Konstrukce SEM
 - Rozlišovací a zvětšovací schopnost SEM
 - Tvorba obrazu (excitovaný objem, informace poskytované různými druhy detekovaných signálů)
 - Požadavky na biologický preparát podle typu SEM
- 4) Jak se připravují preparáty pro TEM?
 - Chemická cesta přípravy preparátů
 - Ultramikrotomie
 - Kryo-postupy v přípravě preparátů
 - Speciální metody a artefakty
- 5) Jak se připravují preparáty pro SEM?
 - Chemické postupy přípravy preparátů
 - Metody sušení
 - Kryo-postupy a jejich aplikace (freeze drying, freeze fracturing, freeze etching)
 - Speciální postupy a artefakty

Materiály a technologie přípravy

- 1) Základní principy elektronové struktury pevných látek, pásová struktura a jejich vliv na vlastnosti látek. Základní představy o krystalová struktuře látky, krystalografické soustavy a poruchy mříže.
- 2) Povrch pevné látky: definice, vlastnosti. Adsorpce, desorpce a metody čištění povrchů. Růst tenkých vrstev, nukleace, strukturní model tenké vrstvy a jeho ovlivnění dopadem těžkých částic nebo teplotou.
- 3) Příprava tenkých vrstev fyzikálními metodami: napařovací metody a odprašování. Příprava tenkých vrstev chemickými metodami z plynné a kapalné fáze: CVD, PECVD, MOCVD, ALD, galvanizace atp.
- 4) Termoemise elektronů, Richards-Dushmanův vztah, termokatody. Výstupní práce a metody měření výstupní práce. Tunelová emise, vliv vnějšího elektrického pole na pásovou strukturu, tunelová mikroskopie.
- 5) Vliv el. mag. záření na pevnou látku. Fotovodivost, fotoodpor, fotočlánek a principy jejich činnosti. Fotoefekt, fotoemise z pevné látky a fotokatody. Fotoelektronová spektroskopie – UPS, XPS, ESCA.
- 6) Dopad nabitych častic na pevnou látku. Augerův jev, spektroskopie emitovaných elektronů, charakteristické a brzdné RTG záření. Odraz a rozptyl elektronů. Metody REED a LEED. Elektron elektronová sekundární emise z pevné látky a její aplikace v měřicí technice.
- 7) Dopad iontů na povrch pevné látky. Sekundární ion elektronová emise, princip a aplikace. Emise neutrálních častic z povrchu. Sekundární iont iontová emise a metoda SIMS.
- 8) Tvrde a otěruvzdorné vrstvy, fotokatalytické materiály a materiály pro palivové a solární články. Příklady a aplikace.

Plazmové a vakuové technologie

- 1) Fyzika nízkých tlaků – objemové procesy
Klasifikace vakua pro technologické účely, vlastnosti plynů, kinetická teorie plynů, pohyb molekul, tepelná transpirace, difúze, přenos tepla, proudění plynu.
- 2) Procesy na površích a ve stěnách vakuových systémů
Pobyt molekuly na stěně, adsorpční teplo, migrace – pohyb adsorbovaných molekul, chemisorpce, vypařování a tlak nasycených par, absorpce, difúze stěnou, pohlcování plynu porézními látkami.
- 3) Získávání nízkých tlaků – čerpání plynu
Pokles tlaku v plynu, čerpací rychlosť zpětný proud, mezní tlak, rozdelení tlaku při čerpání, základní přehled a rozdelení vývěv.
- 4) Vývěvy
Mechanické vývěvy, rotační vývěvy, suché vývěvy scroll, Rootsovy vývěvy, difúzní vývěvy, omezování zpětného proudu, (kryo)sorpční vývěvy.
- 5) Měření nízkých tlaků
Tlak plynů, kapalinové manometry, membránové manometry, ionizační manometry – se studenou a žhavenou katodou.
- 6) Plazma chemický reaktor
Technologické řešení, parametry, uspořádání řešení pro technologické procesy, čerpání systému, objemové a povrchové procesy, čerpání reaktoru, měření tlaků, zdroje plazmatu.
- 7) Plazma a jeho výhody pro technologické aplikace
Definice plazmatu, aktivní částice ve výbojích a jejich vlastnosti, povrchové interakce plazmatu.
- 8) Magnetron pro naprašování tenkých vrstev
Princip magnetronu, jeho výhody a nevýhody, technické řešení, fyzikální princip naprašování tenkých vrstev, magnetrony v komerčních technologických procesech.

Poznámka: při statní zkoušce má student prokázat komplexní znalosti se schopností jejich syntézy; nejedná se o dílčí a detailní zkoušku. Z toho důvodu je potřeba jednotlivé otázky chápout spíše jako okruhy, které se vzájemně prolínají a mezi kterými není ostrá hranice.

Fyzika plazmatu

- 1) Plazma jako ionizovaný plyn
definice plazmatu, nepružné srážky v nízkoteplotním plazmatu - excitace, deexcitace, ionizace, rekombinace, Penningova ionizace, přenos náboje
- 2) Záření plazmatu, difúze plazmatu
fotoexcitace a fotoionizace atomů, funkce profilu čáry a její využití v diagnostice plazmatu, srovnání difúzního koeficientu pro elektrony a ionty, difúzní rozpadová doba a difúzní délka, ambipolární difúze
- 3) Oblast prostorového náboje na rozhraní plazma-pevná látka
plovoucí elektroda v plazmatu; průběh funkce potenciálu před plovoucí elektrodou; Debyeův poloměr
- 4) Plazmová frekvence, šíření elektromagnetických vln v plazmatu
oscilace elektronů a iontů v plazmatu, plazmová frekvence, doba odezvy plazmatu, šíření elektromagnetických vln v plazmatu, využití v diagnostice plazmatu
- 5) Sondová diagnostika plazmatu
měřící obvod s jednou sondou, VA charakteristika sondy a její jednotlivé oblasti, postup měření při sondové diagnostice plazmatu
- 6) Teorie doutnavého výboje
Townsendova teorie výboje, T-koeficient ionizace a T-koeficient sekundární emise, průraz plynu, Paschenův zákon
- 7) Základní charakteristika výboje
VA charakteristika v širokém rozsahu výbojových režimů, popis výbojových režimů, typická struktura doutnavého výboje, rozdělení potenciálu ve výbojích pro plazmové technologie, oblast katodového spádu
- 8) RF výboj
výhody RF výboje, vhodná frekvence pro RF výboje, schéma obvodu RF výboje, časový průběh napětí na RF zdroji a na RF elektrodě, doba iontového bombardování terčové elektrody
- 9) Interakce iontů s povrchem v nízkoteplotním plazmatu
možné procesy a jejich využití v průmyslu, závislost koeficientu odrazu, koeficientu zachycení iontů, koeficientu rozprašování na energii dopadajících iontů, závislost sekundární emise iontů na energii dopadajících elektronů, respektive iontů